



KINTEK SOLUTION

Pacvd Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de **La préparation des échantillons,**
Équipement thermique, Consommables et matériaux de laboratoire,
Équipement biochimique, etc...

KINTEK SOLUTION

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Kintek Solution Ltd est une organisation axée sur la technologie, les membres de l'équipe se consacrent à sonder la technologie et les innovations les plus efficaces et les plus fiables dans l'équipement de recherche scientifique, des domaines tels que la réaction biochimique, la recherche de nouveaux matériaux, le traitement thermique, la création de vide, la réfrigération, ainsi que pharmaceutique et équipement d'extraction de pétrole.

Au cours des 20 dernières années, nous avons acquis une riche expérience dans ce domaine de l'équipement de recherche, nous sommes capables de fournir à la fois l'équipement et la solution en fonction des besoins et des réalités du client, nous avons également développé de nombreux équipements de taille client selon un objectif de travail spécifique, et nous avons beaucoup de projets réussis dans de nombreuses universités et instituts de différents pays, comme l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Moyen-Orient et l'Afrique.

La profession, la réponse rapide, le travail acharné et la sincérité sont une étiquette remarquable de l'attitude de travail des membres de notre équipe, qui nous vaut une solide réputation auprès de nos clients.

Nous sommes ici et prêts à servir nos clients de différents pays et régions, et à partager ensemble la technologie la plus efficace et la plus fiable !



Four Tubulaire À Glissière Pecvd Avec Gazéificateur De Liquide Machine Pecvd

Numéro d'article: KT-PE12



Introduction

Système PECVD à glissière KT-PE12 : large plage de puissance, contrôle de la température programmable, chauffage/refroidissement rapide avec système coulissant, contrôle du débit massique MFC et pompe à vide.

[En savoir plus](#)

Modèle de four	KT-PE12-60
Max. température	1200°C
Température de travail constante	1100°C
Matériau du tube du four	Quartz de haute pureté
Diamètre du tube du four	60mm
Longueur de la zone de chauffage	1x450mm
Matériau de la chambre	Fibre d'alumine du Japon
Élément chauffant	Bobine de fil Cr2Al2Mo2
Taux de chauffage	0-20°C/min
Couple thermique	Construit en type K
Contrôleur de température	Contrôleur PID numérique/contrôleur PID à écran tactile
Précision du contrôle de la température	±1°C
Distance de glissement	600mm
Unité Plasma RF	
Puissance de sortie	5 -500W réglable avec ± 1% de stabilité
Fréquence RF	13,56 MHz ± 0,005 % de stabilité
Puissance de réflexion	350W max.
Correspondant à	Automatique
Bruit	
Refroidissement	Refroidissement par air.
Unité de contrôle précise du gaz	
Débitmètre	Débitmètre massique MFC
Canaux de gaz	4 canaux
Débit	MFC1 : 0-5SCCM O2 MFC2 : 0-20SCMCH4 MFC3 : 0-100 SCCM H2 MFC4 : 0-500 SCCM N2

Linéarité	±0,5 % PE
Répétabilité	±0,2 % PE
Conduite et vanne	Acier inoxydable
Pression de fonctionnement maximale	0.45MPa
Contrôleur de débitmètre	Contrôleur de bouton numérique/contrôleur d'écran tactile
Unité de vide standard (facultatif)	
Pompe à vide	Pompe à vide à palettes
Débit de la pompe	4L/S
Orifice d'aspiration sous vide	KF25
Jauge à vide	Vacuomètre silicone Pirani/Resistance
Pression de vide nominale	10 Pa
Unité de vide poussé (facultatif)	
Pompe à vide	Pompe à palettes rotatives + pompe moléculaire
Débit de la pompe	4L/S+110L/S
Orifice d'aspiration sous vide	KF25
Jauge à vide	Jauge à vide composée
Pression de vide nominale	6x10 ⁻⁵ Pa

Les spécifications et configurations ci-dessus peuvent être personnalisées

Non.	Description	Quantité
1	fourneau	1
2	Tube de quartz	1
3	Bride de vide	2
4	Bloc thermique du tube	2
5	Crochet de bloc thermique de tube	1
6	Gant résistant à la chaleur	1
7	Source de plasma RF	1
8	Contrôle précis du gaz	1
9	Unité de vide	1
dix	Mode d'emploi	1

Machine À Four Tubulaire À Dépôt Chimique Assisté Par Plasma Rotatif Incliné (Pecvd)

Numéro d'article: KT-PE16



Introduction

Présentation de notre four PECVD rotatif incliné pour un dépôt précis de couches minces. Profitez d'une source d'adaptation automatique, d'un contrôle de température programmable PID et d'un contrôle de débitmètre massique MFC de haute précision. Fonctions de sécurité intégrées pour une tranquillité d'esprit.

[En savoir plus](#)

Modèle de four	PE-1600-60
Max. température	1600°C
Température de travail constante	1550°C
Matériau du tube du four	Tube Al2O3 haute pureté
Diamètre du tube du four	60mm
Longueur de la zone de chauffage	2x300mm
Matériau de la chambre	Fibre d'alumine du Japon
Élément chauffant	Disiliciure de molybdène
Taux de chauffage	0-10°C/min
Couple thermique	Type B
Contrôleur de température	Contrôleur PID numérique/contrôleur PID à écran tactile
Précision du contrôle de la température	±1°C
Unité Plasma RF	
Puissance de sortie	5 -500W réglable avec ± 1% de stabilité
Fréquence RF	13,56 MHz ± 0,005 % de stabilité
Puissance de réflexion	350W max.
Correspondant à	Automatique
Bruit	
Refroidissement	Refroidissement par air.
Unité de contrôle précise du gaz	
Débitmètre	Débitmètre massique MFC
Canaux de gaz	4 canaux
Débit	MFC1 : 0-5SCCM O2 MFC2 : 0-20SCMCH4 MFC3 : 0-100 SCCM H2 MFC4 : 0-500 SCCM N2

Linéarité	±0,5 % PE
Répétabilité	±0,2 % PE
Conduite et vanne	Acier inoxydable
Pression de fonctionnement maximale	0.45MPa
Contrôleur de débitmètre	Contrôleur de bouton numérique/contrôleur d'écran tactile
Unité de vide standard (facultatif)	
Pompe à vide	Pompe à vide à palettes
Débit de la pompe	4L/S
Orifice d'aspiration sous vide	KF25
Jauge à vide	Vacuomètre silicone Pirani/Resistance
Pression de vide nominale	10 Pa
Unité de vide poussé (facultatif)	
Pompe à vide	Pompe à palettes rotatives + pompe moléculaire
Débit de la pompe	4L/S+110L/S
Orifice d'aspiration sous vide	KF25
Jauge à vide	Jauge à vide composée
Pression de vide nominale	6x10 ⁻⁵ Pa
Les spécifications et configurations ci-dessus peuvent être personnalisées	

Non.	Description	Quantité
1	fourneau	1
2	Tube de quartz	1
3	Bride de vide	2
4	Bloc thermique du tube	2
5	Crochet de bloc thermique de tube	1
6	Gant résistant à la chaleur	1
7	Source de plasma RF	1
8	Contrôle précis du gaz	1
9	Unité de vide	1
dix	Mode d'emploi	1

Machine De Revêtement Par Évaporation Améliorée Par Plasma Pecvd

Numéro d'article: KT-PED



Introduction

Améliorez votre processus de revêtement avec l'équipement de revêtement PECVD. Idéal pour les LED, les semi-conducteurs de puissance, les MEMS, etc. Dépose des films solides de haute qualité à basse température.

[En savoir plus](#)

Porte-échantillon	Taille	1-6 pouces
	Vitesse de rotation	0-20rpm réglable
	Température de chauffage	≤800°C
	Précision du contrôle	±0.5°C Contrôleur PID SHIMADEN
Purge de gaz	Débitmètre	CONTRÔLEUR DE DÉBITMÈTRE MASSIQUE (MFC)
	Canaux	4 canaux
	Méthode de refroidissement	Refroidissement par circulation d'eau
Chambre à vide	Taille de la chambre	Φ500mm X 550mm
	Port d'observation	Port d'observation avec déflecteur
	Matériau de la chambre	Acier inoxydable 316
	Type de porte	Porte à ouverture frontale
	Matériau du capuchon	Acier inoxydable 304
	Orifice de la pompe à vide	Bride CF200
	Orifice d'entrée de gaz	φ6 Connecteur VCR
Puissance du plasma	Alimentation de la source	Alimentation DC ou RF
	Mode de couplage	Couplage inductif ou capacitif à plaque
	Puissance de sortie	500W-1000W
	Puissance de polarisation	500v
Pompe à vide	Pré-pompe	Pompe à vide à palettes 15L/S
	Orifice de la turbopompe	CF150/CF200 620L/S-1600L/S
	Orifice de décharge	KF25
	Vitesse de la pompe	Pompe à palettes:15L/s[]Turbo pompe:1200l/s[]1600l/s
	Degré de vide	≤5×10-5Pa
	Capteur de vide	Jauge à vide à ionisation/résistance/jauge à film
Systeme d'alimentation	Alimentation électrique	AC 220V /380 50Hz

Puissance nominale	5kW
Dimensions de l'appareil	900mm X 820mm X 870mm
Poids	200 kg



Kintek Solution

Siège social : No.11 Changchun Road, Zhengzhou, Chine

